

(別紙 1)

教育研究設備整備計画表					
(単位:千円)					
年度別設備名	区分	新規/更新等	特別経費	法人内経費	
今 中 期 計 画 期 間	平成 26 年度		171,000	43,000	
	共焦点スペクトルイメージャー	基盤の大型	新規	71,000	
	先端ナノマシン材料システム 一式	基盤の大型	更新	100,000	
	基礎科学実験分光分析システム	基盤の設備	更新		24,000
	ワイヤー放電加工機	基盤の設備	新規		19,000
	平成 27 年度		200,000	38,000	
	高分解能走査型電子顕微鏡	基盤の大型	更新	80,000	
	多機能 X 線分析システム	基盤の大型	更新	120,000	
	ICT 活用アナログ回路実験設備	基盤の設備	更新		23,000
	操作フライス盤(一号機)	基盤の設備	更新		15,000
次 中 期 計 画 期 間	平成 28 年度以降		299,000	88,000	
	二重収束質量分析計	基盤の大型	更新	52,000	
	デバイスプロセス評価装置 一式	基盤の大型	更新	66,000	
	宇宙通信工学実習設備	基盤の大型	更新	37,000	
	X 線回折実験実習システム	基盤の設備	更新		30,000
	CNC/精密旋盤(一号機, 二号機)	基盤の設備	更新		20,000
	高分解能 X 線回折装置	基盤の大型	更新	50,000	
	結晶方位分散分析走査型電子顕微鏡	基盤の大型	更新	94,000	
	操作フライス盤(二号機)	基盤の設備	更新		15,000
	電子線元素状態分析用実験・実習システム	基盤の設備	更新		23,000
合 計			670,000	169,000	